

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
19 mai 2005 (19.05.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/046296 A3

(51) Classification internationale des brevets⁷ : **H05H 1/18**

(72) Inventeurs; et

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/002821

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **HITZ, Denis** [FR/FR]; 5, avenue du Grand Châtelet, F-38100 Grenoble (FR). **CORMIER, David** [FR/FR]; 16, rue Saint Amable, F-63200 Riom (FR).

(22) Date de dépôt international :

3 novembre 2004 (03.11.2004)

(74) Mandataire : **SANTARELLI**; 14, avenue de la Grande-Armée, Boîte postale 237, F-75822 Paris Cedex 17 (FR).

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

0312934

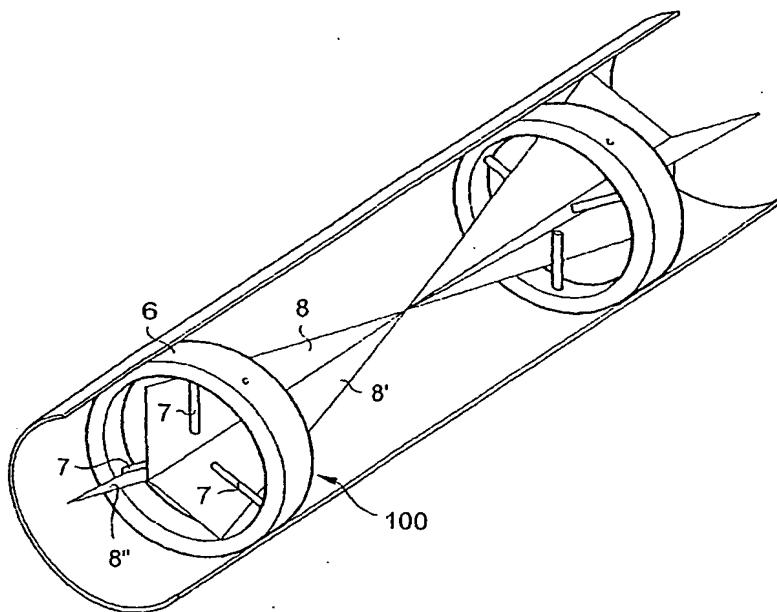
4 novembre 2003 (04.11.2003) FR

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DEVICE FOR CONTROLLING THE ELECTRONIC TEMPERATURE IN AN ECR PLASMA

(54) Titre : DISPOSITIF POUR CONTROLER LA TEMPERATURE ELECTRONIQUE DANS UN PLASMA RCE



(57) Abstract: The invention relates to a device which is used to control the electronic temperature in an ECR plasma chamber (1). The inventive device comprises at least one moderator (100) which is placed on the path of electrons having an energy greater than a pre-determined energy, such as to form an obstacle to said electrons. The invention is suitable for use in relation to ion sources and plasma machines.

[Suite sur la page suivante]

WO 2005/046296 A3